при различных температурах термооораоотки	
Режим термообработки	Время затухания
	люминесценции, т <sub>1/е</sub> , нс
720 °С/6 ч + 800 °С/6 ч	260±10
720 °С/6 ч + 850 °С/6 ч	280±10
720 °С/6 ч + 900 °С/6 ч	260±10
720 °С/6 ч + 1000 °С/3 ч	250±10

Таблица 1 – Времена затухания люминесценции для образцов стеклокерамики, приготовленных при различных температурах термообработки

Новые цинк-галлиоалюмосиликатные ситаллы на основе нанокристаллов шпинели Zn(Ga,Al)<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, легированные Co<sup>2+</sup>, были получены традиционным методом закалки в расплаве с контролируемой кристаллизацией.

Изучены люминесцентные свойства данных материалов, а также получены характерные времена затухания люминесценции. Показано, что люминесцентные свойства ситаллов определяются в основном тетраэдрически координированными ионами Co<sup>2+</sup>, расположенными в нанокристаллах Zn(Ga,Al)<sub>2</sub>O<sub>4</sub> со структурой шпинели.

## Литература

1. Karlsson G., Laurell F., Tellefsen J., Denker B., Galagan B., Osiko V., Sverchkov S. // Appl. Phys. B. 2002. – V. 75. – P. 41.

2. Yumashev K.V., Denisov I.A., Posnov N.N., Prokoshin P.V., Mikhailov V.P. // Appl. Phys. B. - 2000. - V. 70. - P. 179.

3. Papalardo R., Wood D.L., Linares R.C., Jr. // J. Chem. Phys. -1961. - V. 35. - P. 2041.

4. Holand W., Beall G.H. Glass Ceramic Technology, 2nd Edition. Wiley, 2012. – 440 p.

5. I.A. Denisov, Yu.V. Volk, A.M. Malyarevich, K.V. Yumashev, O.S. Dymshits, A.A. Zhilin, U. Kang, K.-H. Lee, Linear and nonlinear optical properties of cobaltdoped zinc aluminum glass ceramics. J. Appl. Phys. 93 (7) (2003) 3827-3831.

6. P. Loiko, A. Belyaev, O. Dymshits, I. Evdokimov, V. Vitkin, K. Volkova, M. Tsenter, A. Volokitina, M. Baranov, E. Vilejshikova, A. Baranov, A. Zhilin, Synthesis, characterization and absorption saturation of Co:ZnAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (gahnite) transparent ceramic and glassceramics: A comparative study, J. Alloys Compnd 725 (2017) 998-1005.

УДК 621.375.826

## СИНТЕЗ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ Er:Y2O3 И Er:YAG

Горбаченя К.Н.<sup>1</sup>, Кисель В.Э.<sup>1</sup>, Лопухин К.В.<sup>2</sup>, Балашов В.В.<sup>2</sup>, Федин А.В.<sup>3</sup>, Герке М.Н.<sup>3</sup>, Кулешов Н.В.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Оптических материалов и технологий» БНТУ Минск, Республика Беларусь <sup>2</sup>Фрязинский филиал института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН Фрязино, Российская Федерация <sup>3</sup>Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Владимир, Российская Федерация

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к разработке и созданию лазеров, работающих в условно безопасном для глаз спектральном диапазоне 1.5–1.6 мкм, в том числе для лазерных локаторов беспилотного транспорта. Однако до сих пор актуальным вопросом является поиск эффективной лазерной среды, обеспечивающей возможность получения лазерной генерации с высокой средней выходной мощностью. На сегодняшний день основными эрбиевыми материалами остаются фосфатные стекла, характеризующиеся малой теплопроводностью (~ 0,85 Вт/м\*К), что ограничивает их применение в мощных лазерах. В настоящее время внимание исследователей смещается на материалы, которые обеспечивают сочетание спектроскопических характеристик, необходимых для получения эффективной лазерной генерации, и высокой теплопроводности матриц (> 3 Вт/м\*К). Применение таких активных сред в дальнейшем позволяет создавать лазеры, генерирующие излучение с высокой средней выходной

мощностью (> 1 Вт) в непрерывном и импульсном режимах, для применения в лазерной дальнометрии, медицине, системах оптической локации и лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии.

Появление доступных источников накачки диодов на основе соединений лазерных InGaAsP/InP, излучающих в области 1,5 мкм, с приемлемыми пространственными и спектральными характеристиками пучка вызвало повышенный интерес исследователей к изучению генерационных характеристик материалов, активированных только ионами Ег<sup>3+</sup>, при резонансной накачке непосредственно на верхний лазерный уровень <sup>4</sup>I<sub>13/2</sub>. В этом случае тепловыделение изза малой относительной разности энергий квантов накачки и генерации сводится к минимуму. Открывается возможность применения материалов с низкой эффективностью переноса энергии от ионов иттербия к ионам эрбия в качестве активных сред лазеров спектрального диапазона 1,5-1,6 мкм. Ранее сообщалось о получении лазерной генерации с резонансной накачкой на основе различных эрбийсодержащих оксидных материалов, таких как кристаллы гранатов YAG, ванадатов ReVO4 (Re=Y, Gd) и полуторных оксидов Re<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Re=Sc, Lu) [1-4]. Группа редкоземельных полуторных оксидных кристаллов Er:Re<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Re=Sc, Lu) характеризуется наибольшим значением теплопроводности из рассматриваемых кристаллов (~ 12,6 Вт/м×К для кристалла  $Er:Lu_2O_3).$ При использовании кристалла Er:Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub> получен непрерывный режим генерации дифференциальной эффективностью с ло 45 % [4]. Однако основным недостатком полуторных оксидных кристаллов является технологическая сложность их роста - температура плавления для указанных кристаллов составляет 2400 °С. Одним из решений описанных проблем, связанных с ростом кристаллов, является применение оптической керамики на основе указанных кристаллов. Современная технология изготовления оптической керамики позволяет получать материалы больших размеров с оптическим качеством, как правило, не уступающим по качеству соответствующим монокристаллам. Кроме того, стоимость изготовления оптической керамики существенно ниже роста монокристаллов, что в конечном итоге приводит к уменьшению себестоимости лазера.

Исследованные образцы керамики Er(0.5 ат.%): YAG были изготовлены методом реактивного спекания в вакууме. Для этого были взяты коммерчески доступные порошки У2О3, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. В качестве спекающих добавок были использованы SiO2 и B2O3. Порошки были смешаны в стехиометрических пропорциях и помолоты в планетарной мельнице в среде безводного спирта в течение 15 часов, а потом высушены и протерты через сито. После протирки порошки были отожжены при 1 000 °С для удаления органики. Полученные порошки были отпрессованы сначала одноосным прессованием при 100 МПа в стальной форме диаметром 10 мм или при 20 МПа в стальной форме диаметром 27 мм, а потом в изостатическом прессе при 250 МПа в течение 5 минут. После первого этапа прессовки компакты были отожжены при 600 °С, а после 2-ого этапа при 800 °С для окончательного удаления всех летучих примесей. Полученные компакты были спечены в вакуумной печи с вольфрамовыми нагревателями при температуре 1 750 °С в течение 21 часа. После спекания образцы были отожжены при 1 100°С в течение 36 часов для удаления кислородных вакансий. Образцы Er(0,5 ат. %)Y2O3: были изготовлены по аналогичной технологии. В качестве спекающих добавок использовались La2O3 (0,5 ат.%) и ZrO<sub>2</sub> (1,5 ат. %). Спекание проводилось при температуре 1860 °С в течение 10 часов. Отжиг после спекания проводился при температуре

1400°С в течение 15 часов. Все отжиги проводились в воздушной атмосфере. После финального отжига образцы были отполированы. На рисунке 1 приведены фотографии синтезированных образцов оптической керамики Er:Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и Er:YAG.



Рисунок 1 - Оптическая керамика Er:Y2O3 и Er:YAG

Измерение абсорбционных свойств оптической керамики Er:Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> И Er:YAG производилось при комнатной температуре на двухлучевом спектрофотометре Varian CARY 5 000 в спектральной области 1 400–1 700 нм, соответствующей энергетическому переходу <sup>4</sup>I<sub>15/2</sub>→<sup>4</sup>I<sub>13/2</sub> ионов эрбия, Спектральное разрешение прибора составляло 0,5 нм. При определении коэффициентов поглощения было учтено френелевское отражение от полированных поверхностей образцов. По спектрам коэффициентов поглощения и содержанию ионов-активаторов были определены спектры поперечных сечений поглощения.

На рисунке 2 представлены спектры поперечных сечений поглощения оптической керамики Er:Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Максимальное поперечное сечение поглощения составляет  $2,1\cdot10^{-20}$  см<sup>2</sup> на длине волны 1 535 нм. Значение поперечного сечения поглощения на длине волны 1 531 нм, на которой излучает источник накачки, который планируется использовать при проведении лазерных экспериментов и исследовании генерационных характеристик, составляет  $0,42\cdot10^{-20}$  см<sup>2</sup>.



Рисунок 2 – Спектры поперечных сечений поглощения оптической керамики Er:Y2O3

На рисунке 3 представлены спектры поперечных сечений поглощения оптической керамики Er:YAG.

Значение поперечного сечения поглощения на длине волны 1 531 нм составляет 0,4·10<sup>-20</sup> см<sup>2</sup>.



Рисунок 3 – Спектры поперечных сечений поглощения оптической керамики Er:YAG

УЛК 621.315.592

## Литература

1. D. Garbuzov, I.Kudryashov, M. Dubinskii «Resonantly diode laser pumped 1.6-µm-erbium-doped yttrium aluminum garnet solid-state laser». Appl. Phys. Lett. – Vol. 87, № 12, 131115-131118 (2005).

2. N. Ter-Gabrielyan [et al.] «Nearly quantum-defectlimited efficiency, resonantly pumped, Er<sup>3+</sup>:YVO<sub>4</sub> laser at 1593.5 nm». Opt.Lett. Vol. 36, № 7, 1218–1220 (2011).

3. L.D. Merkle [et al.] «Er:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – laser-related spectroscopy». Opt. Mat. Express. Vol. 3, № 11, 1992–2002 – (2013). 4. N. Ter-Gabrielyan [et al.] «Ultralow quantumdefect eye-safe Er:Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub> laser». Opt. Lett. Vol. 33, № 13, 1524–1526 (2008).

## ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГЕРМАНИЙ-КРЕМНИЕВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ Гацкевич Е.И.<sup>1</sup>, Ивлев Г.Д.<sup>2</sup>, Гундина М.А.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь <sup>2</sup>Белорусский государственный университет Минск, Республика Беларусь

Одна из актуальных проблем полупроводниковой оптоэлектроники - создание эффективных источников света на основе германия, излучающих при комнатной температуре в ближней инфракрасной (ИК) области (λ = 1,5-1,6 мкм). На основе гетероструктур Ge/Si была получена лазерная генерация при оптической и электрической накачке [1, 2]. Твердые растворы Ge<sub>x</sub>Si<sub>1-x</sub> с задаваемой параметром «х» шириной запрещенной зоны применяются при создании различных микро- и оптоэлектронных приборных структур. Однако эффективность таких лазерных структур пока остается сравнительно низкой, а методы их создания (например, сверхвысоковакуумная молекулярно-лучевая эпитаксия) усложняют кремниевую технологию. Требуется поиск альтернативных методов создания Ge<sub>x</sub>Si<sub>1-x</sub> слоев, совместимых с кремниевой планарной технологией. Таким методом может быть импульсная лазерная обработка (ИЛО). Эффекты ИЛО различных германий кремниевых структур в наносекундном диапазоне длительностей воздействующего излучения исследовались в ряде работ [3]. При импульсных воздействиях на гетероструктуры и твердые растворы происходит перераспределение элементного состава. В настоящей работе изучено перераспределение элементов по глубине в Ge/Si гетероструктурах (ГС) при ИЛО методом вторично-ионной масс-спектроскопии.

В качестве объектов исследования использовались Ge/Si ГС, приготовленные вакуумтермическим напылением германия на подложку Si(100). Толщина аморфной плёнки германия составляла 70 нм. Исследуемые образцы облучались пучком рубинового лазера (длительность импульса 70–80 нс по уровню 0,5) с заданными плотностями энергии W при неоднородности её распределения не выше ± 5 % по облучаемой зоне диаметром 3-4 мм. Одновременно проводилось оптическое зондирование зоны ИЛО на  $\lambda_1 = 0,53$  и/или  $\lambda_2 = 1,06$  мкм путём детектирования отражённого от неё пробного пучка. Источником зондирующего излучения являлся лазер на стекле, активированном неодимом, работающий в режиме свободной генерации – генерации «гладкого» импульса длительностью 0,5 мс. Оба лазера работали в режиме взаимно синхронизированных одиночных вспышек. Величина плотности энергии облучения W для изучения влияния ИЛО на перераспределение элементного состава варьировалась калиброванными нейтральными фильтрами от 0,25 до 4 Дж/см<sup>2</sup>.

ВИМС-измерения проводились на установке ТОF.SIMS-5 с времяпролётным масс - анализатором и двумя ионными пушками – для распыления и зондирования, на которой ранее авторами работ [4, 5] выполнялись исследования подобных германий – кремниевых структур. Данные ВИМС, были получены послойным анализом ГС при распылении тестируемой области образцов (~1 мкм<sup>2</sup>) ионами Cs<sup>+</sup> с энергией 1 кэВ (ток пучка 70 нА) и зондировании ионами Bi<sup>+</sup> (25 кэВ, 1 нА). В процессе распыления регистрировались элементарные вторичные ионы Ge<sup>-</sup> и Si<sup>-</sup>, а также кластерные Ge<sub>2</sub><sup>-</sup>, детектирование которых проводилось для выявления по известной методике [5] присутствия нанокластеров (наноостровков) германия в анализируемых слоях.

Как следует из данных, представленных на рисунке 1, вследствие ИЛО ГС при  $W = 3.6 \, \text{Дж/см}^2$  формируется бинарная система  $\text{Ge}_x \text{Si}_{1-x}$  с параметром «х», уменьшающимся от